

ドライエッチングシステム（CDE-7-4） オペレーショントレーニング開催のお知らせ

（学外参加者は有料となります）

この度、本装置のオープンファシリティー（OF）登録に併せ、ドライエッチングシステム（CDE-7-4：芝浦メカトロニクス社）のメーカースタッフによるオペレーショントレーニングを開催いたします。今後ご使用予定の方、ケミカルドライエッチングに興味をお持ちの方は是非ともお越しください。



特 徴

- ・プラズマ発生部と処理（エッチング）部が完全に分離したリモートプラズマ方式であるため、プラズマダメージが入りません。
- ・6インチウェハーに対応していますが、数ミリ角の小さな試料も処理することができます。
- ・Siの表面や溝の平滑化・ドライ洗浄、DRIE後のスキヤロップ除去などが可能です。
- ・プラズマ電源：マイクロ波 2.45GHz 1kW、エッチングガス：CF₄, O₂, N₂.

【日時】 8月6日（月）13時～17時

【場所】 筑波大学 総合研究棟B 0022室

【内容】

- ・CDE (Chemical Dry Etching) とは？
- ・CDE-7-4 装置概要
- ・CDEの主なプロセス・最近の用途
- ・実機使用実習
- ・ご質問等その他

**参加者募集！
（若干名）**

装置を熟知したメーカースタッフにお話がうかがえ、実機指導も受けられます。

締切 8月1日（水）

お問い合わせ

国立大学法人筑波大学
数理物質系 パワーエレクトロニクス共用システム（パワエレ共用）
〒305-8577 茨城県つくば市天王台1-1-1

E-mail: sharing-power-e@ml.cc.tsukuba.ac.jp

URL: <http://shared-pe.bk.tsukuba.ac.jp>